

1-4 細り／线细／Conductor width reduction

1-4-1 ET 過多（細り）／ET 过度（细）／Caused by over etch(Conductor width reduction)

1-4-1-1 全体的細り／整体的线细／Reduced width throughout the conductor width

【特徴】 総ての回路が全体的に細っており、ロット内製品は同一である点が特徴

【特征】 其特点是全部线路整体上偏细，批号内的产品几乎相同。

【Characteristics】 Conductor width is reduced throughout the conductor. The products in the same lot are all affected.

【原因・判断ポイント・発生工程】 E T コンベア速度が遅過ぎたり、E T 条件が過酷過ぎたりして、E T 侵食量が多くなって出来たもの（E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】ET 传送速度太慢、或者 ET 条件太苛刻、ET 量太大而引起的（ET 工序）。

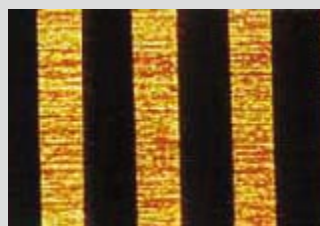
【Causes/processes involved/keys to judgment】 Excessive etching due to too slow an etching conveyor speed or too high etching rate causes the defect. (Etching process)



【コメント】
細り品
顕微鏡倍率×60

【注釋】
线细产品
显微镜倍率 ×60

【Comments】
Product of reduced width
Magnification: ×60



【コメント】
正常品
顕微鏡倍率×60

【注釋】
正常产品
显微镜倍率 ×60

【Comments】
Good product
Magnification: ×60

1-4-1-2 部分的細り／局部的线细／Locally reduced width of conductor

【特徴】 回路線の一部が細くなっている状態の欠陥

【特征】 线路的局部变细的缺陷。

【Characteristics】 The width of a part of a conductor is reduced.

【原因・判断ポイント・発生工程】 D F R の部分的密着不良により回路線が E T 液に食われて出来たもの（露光焼付～E T 工程）



【コメント】
顕微鏡倍率×60

【注釋】
显微镜倍率 ×60

【Comments】
Magnification: ×60